【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年1月24日(2019.1.24)

【公開番号】特開2017-191153(P2017-191153A)
【公開日】平成29年10月19日(2017.10.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-040
【出願番号】特願2016-79313(P2016-79313)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｂ　5/30　(2006.01)
Ｇ０２Ｆ　1/13363　(2006.01)
Ｃ０８Ｌ　1/10　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/3477　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/3445　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｂ　5/30
Ｇ０２Ｆ　1/13363
Ｃ０８Ｌ　1/10
Ｃ０８Ｋ　5/3477
Ｃ０８Ｋ　5/3445

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月5日(2018.12.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
式中、※印は、一般式（１）におけるL_1、L_2、L_3又はL_4との結合位置を表す。R^5は水素原子又は非芳香族置換基を表す。R^5で表される非芳香族置換基としては、前記一般式（１）におけるA_1が有してもよい置換基のうちの非芳香族置換基と同様の基を挙げることができる。光学的特性の変動抑制効果を高めるためには、R^5は水素原子、炭素数１～５のアルキル基又は炭素数１～５のアシル基であることが好ましく、水素原子であることが特に好ましい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
上記一般式（３）において、Ａはピラゾール環を表し、Ar_1及びAr_2はそれぞれ芳香族炭化水素環又は芳香族複素環を表し、置換基を有してもよい。R_1は水素原子、アルキル基、アシル基、スルホニル基、又はアルキルオキシカルボニル基を表す。ｑは１～２の整数を表し、ｎ及びｍはそれぞれ１～３の整数を表す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】

【００９５】

R_1の具体例としては、アルキル基（メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｎ－オクチル基、２－エチルヘキシル基等）、アシル基（アセチル基、ピバロイルベンゾイル基等）、スルホニル基（例えば、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基等）、アルキルオキシカルボニル基（例えば、メトキシカルボニル基）等が挙げられる。